

铝钪合金靶 (AlSc)

产品介绍

近年来，氮化铝掺钪的 ScAlN 薄膜广泛投入使用，得益于其优异的压电性能，可以用于下一代 MEMS 传感器和器件中，汽车、物联网和手持设备等可以使用到这样的材料。ScAlN 薄膜通常通过反应溅射 AlSc 靶材来生产，但是由于高质量 AlSc 溅射靶材的供应量少，尤其是钪含量大于 20at% 的，AlSc 靶材的采用数量和技术发展受到了一定的限制。

先导薄膜材料增加对生产设备的投资，扩大了生产规模，以满足行业对高质量、高含量的 AlSc 溅射靶材的需求。先导薄膜材料可提供 $\Phi 340\text{mm}$ 的 AlSc 靶材，Sc 含量可达 40at%。还提供钼或扩散绑定，绑定率大于 98%。我们供应的靶材配置均支持 fxP200 和 ARQ151-8” 阴极，其他特殊形状和成分的靶材制作可在 6-8 周内完成。

	Sc $\leq 9.6\text{at}\%$	$>9.6\text{at}\%$ to $\leq 20\text{at}\%$	$>20\text{at}\%$ to $\leq 30\text{at}\%$	Sc $>30\text{at}\%$
纯度	$\geq 3\text{N}5$ (99.95%)	$\geq 3\text{N}5$ (99.95%)	$\geq 3\text{N}5$ (99.95%)	$\geq 3\text{N}5$ (99.95%)
钪含量	$\pm 0.5\text{wt}\%$	$\pm 0.8\text{wt}\%$	$\pm 1.0\text{wt}\%$	$\pm 1.0\text{wt}\%$
密度	$\geq 99.5\%$ 理论密度	$\geq 99.5\%$ 理论密度	$\geq 99.5\%$ 理论密度	$\geq 99.5\%$ 理论密度
平均晶粒尺寸	$\leq 50\mu\text{m}$	$\leq 80\mu\text{m}$	$\leq 100\mu\text{m}$	$\leq 100\mu\text{m}$
氧含量	$\leq 300\text{ppm}$	$\leq 300\text{ppm}$	$\leq 500\text{ppm}$	$\leq 2000\text{ppm}$
尺寸	$\Phi 340\text{mm}$	$\Phi 340\text{mm}$	$\Phi 340\text{mm}$	$\Phi 340\text{mm}$

*尺寸可按客户要求定制

回收服务

先导薄膜材料对原材料有着严格的控制，凭借独家的回收和提纯服务，可以确保 AlSc 稳定的供应以及稳定的质量。先导薄膜可以通过完整的闭环回收服务来回收 AlSc 残靶，从而可以降低客户成本，因此拥有独特的优势来服务客户。先导薄膜材料已经建立了一套完整的“租赁”体系，基于客户的使用率或信用记录，以及回收的钪价值，按每日价格来计算扣除回收费用。

先导薄膜材料已全面通过 ISO9001, ISO14001, ISO14021 和 OHSAS18001 认证。

